PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-144358

(43)Date of publication of application: 25.05.2001

(51)Int.CI.

H01S 3/17 C03C 3/062 C03C 3/068 C03C 3/095 C03C 3/097 C03C 3/15 C03C 4/12

(21)Application number: 11-287354

07.10.1999

(71)Applicant : ASAHI GLASS CO LTD

(72)Inventor: TANABE SETSUHISA

SUGIMOTO NAOKI

ITO SETSUO

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 10298625

Priority date : 20.10.1998

Priority country: JP

11120526

27.04.1999

JP

11250654

03.09.1999

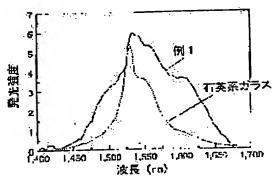
JP

(54) LIGHT-AMPLIFYING GLASS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain light amplifying glass with which the width of wavelength where the gain obtained is 80 nm or higher and thermal damages caused by laser beams can be restrained.

SOLUTION: In this light amplifying glass, 0.01-10 wt.% of Er is added to the matrix glass which includes Bi2O3, CeO2 and at least one of B2O3 and SiO2 as essentials and in which their contents are respectively 0-74.89 mol%, 0-79.99 mol%, 20-80 mol%, and 0.01-10 mol%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開 2 0 0 1 - 1 4 4 3 5 8 (P 2 0 0 1 - 1 4 4 3 5 8 A) (43)公開日 平成13年5月25日(2001. 5. 25)

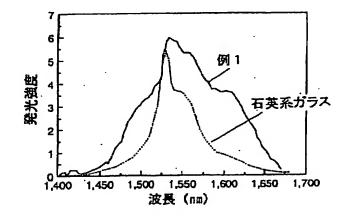
(51) Int. C1. 7	識別記 号	FI	テーマコード(参考)
H01S 3/	17	H01S	3/17 4G062
C 0 3 C 3/0	062	C 0 3 C	3/062 5F072
	o68 ·		3/068
3/0	095		3/095
3/0	097		3/097
	審査請求 未請求 請求項の数5	OL	(全10頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		(71)出願人	00000044
(21) [2]			旭硝子株式会社
(22)出顧日	平成11年10月7日(1999.10.7)		東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
(88) [28]	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	田部 勢津久
(31)優先権主張番号	特願平10-298625		京都府京都市伏見区深草西浦町3-89 シ
(32)優先日	平成10年10月20日(1998.10.20)		ャトー深草1 s t 20 A
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	杉本 直樹
(31)優先権主張番号			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
(32)優先日	平成11年4月27日(1999. 4. 27)		旭硝子株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	伊藤 節郎
(31)優先権主張番号			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
(32)優先日	平成11年9月3日(1999.9.3)		旭硝子株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)		
(55) 凌儿惟王派巴	四年(3 4 /		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光増幅ガラス

(57)【要約】

【課題】利得が得られる波長幅が80nm以上、かつレーザー光による熱的損傷が起りにくい光増幅ガラスを得る。

【解決手段】 B_2O_3 と S_iO_2 の内の少なくともいずれか1種と $B_{i_2}O_3$ と C_eO_2 とを必須とし、それらの含有量がそれぞれモル%で、 $0\sim74$. 89、 $0\sim79$. 99、 $20\sim80$ 、0. $01\sim10$ であるマトリクスガラスに、0. $01\sim10$ 重量%の E_r を添加した光増幅ガラス。



【特許請求の範囲】

【請求項1】マトリクスガラスに0.01~10重量% のErを添加した光増幅ガラスであって、該マトリクス ガラスが、実質的にモル%表示で、

20~80 B i 2O3 0~74.89、 B_2O_3 $0 \sim 79.99$ SiO2 CeO_2 0. 01~10, $0 \sim 50$ Li₂O $0 \sim 50$ TiO2 ZrO2 $0 \sim 50$ $0 \sim 50$ SnO2 $0 \sim 30$ WОз TeO2 $0 \sim 30$ $0 \sim 30$ Ga₂O₃ 0~10. A 1 2 O 3

からなり、かつ、B2O3およびSiO2の内の少なくと もいずれか一方を含有することを特徴とする光増幅ガラ

【請求項2】前記マトリクスガラスが、実質的にモル% 20 表示で、

 $20 \sim 70$ B i 2O3

 $0 \sim 14.99$ B₂O₃

 $15 \sim 79.99$ SiO2

 $0.01 \sim 10$ CeO2

からなる請求項1に記載の光増幅ガラス。

【請求項3】前記マトリクスガラスが、実質的にモル% 表示で、

 $30 \sim 80$ B i 2O3 $15 \sim 69$ BaOa $0 \sim 50$ S i O₂ $0.01 \sim 10$ CeO2 $0 \sim 50$. Li2O TiO2 $0 \sim 50$ $0 \sim 50$ ZrO2 $0 \sim 50$ SnO2

からなり、前記マトリクスガラスにおけるSiO2、L i₂O、TiO₂、ZrO₂およびSnO₂の含有量の合計 が0~50モル%である請求項1に記載の光増幅ガラ

【請求項4】前記マトリクスガラスが、実質的にモル% 表示で、

25~70、 B i 2O3

 $0 \sim 74.89$ B₂O₃

 $0 \sim 74.89$ SiO2

 $0.01 \sim 10$ CeO₂

WO₃ $0 \sim 30$

 $0 \sim 30$ TeO2

 $0 \sim 30$ Ga₂O₃

びSiO₂の含有量の合計が5~74.89モル%、か つ、WO₃、TeO₂およびGa₂O₃の含有量の合計が 0.1~30モル%である請求項1に記載の光増幅ガラ

【請求項5】前記マトリクスガラスが、実質的にモル% 表示で、

 $25 \sim 70$ B i 2 O 3 $0 \sim 74.79$ B₂O₃

 $0 \sim 74.79$ SiO2

 $0.01 \sim 10$ 10 C e O₂

> $0 \sim 30$. WОз

> TeO2 $.0 \sim 30$

Ga₂O₃ 0~30

 $0.1 \sim 10$ A 1 2 O 3

からなり、前記マトリクスガラスにおいて、B2O3およ びSiO₂の含有量の合計が5~74.79モル%、か つ、WO₃、TeO₂およびGa₂O₃の含有量の合計が 0.1~30モル%である請求項1に記載の光増幅ガラ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光増幅ガラスに関 する。特に、1.5~1.6μmの波長の光に対し、広 帯域で増幅可能な光増幅ガラスに関する。

[0002]

【従来の技術】光通信システムにおける光増幅器への応 用を目的として、コアガラスとクラッドガラスからな り、該コアガラスが希土類元素が添加されたガラスであ る光増幅媒体(光増幅ファイバ、光増幅導波路、等)の 30 開発が進められている。特に、前記希土類元素がEェ (エルビウム) である光増幅媒体が盛んに開発されてい

【0003】一方、将来見込まれる通信サービスの多様 化に対応するために、伝送容量の拡大を図る波長多重光 通信方式 (WDM) が提案されている。WDMにおいて は、波長多重のチャンネル数が増加するほど伝送容量が 大きくなる。そのため、WDMで使用される1.5~ 1. 6 μ mの波長の光に対し広帯域で増幅可能な光増幅 媒体が求められている。

40 【0004】従来知られているEr添加石英系ガラスフ ァイバの場合、1.5~1.6μmの波長の光に対し利 得が得られる波長幅は狭く、10~30nm程度であ る。その結果、波長多重チャンネル数は30~40チャ ンネル程度に限られる。この他にEr添加フッ化物ファ イバも提案されているが、前記波長幅はやはり30nm 程度であり、充分ではない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記波長幅をより大き くするために、波長に対する増幅利得特性が異なる光増 からなり、前記マトリクスガラスにおいて、B2O3およ 50 幅器を直列や並列に配置することによって広帯域で増幅 可能とした光増幅器が提案されている。しかしこの光増幅器には、構造が煩雑になったり、波長域の中心付近に 増幅できない領域が存在したりする問題があった。

【0006】また、特開平8-110535には、Erが添加された酸化テルライド系ガラスをコアガラスとする光増幅媒体が開示されている。たとえば、TeO2:75モル%、ZnO:13モル%、Na2O:3モル%、Bi2O3:4モル%、P2O5:5モル%、からなるガラスにErを1000ppm添加したコアガラスを有する光増幅ガラスファイバにおいて、利得が得られる波 10 長幅は70nmであった、とされている。

【0007】一方、光増幅のための励起光として強度の大きいレーザー光を使用するとガラスが熱的に損傷する問題もあった。本発明は、 $1.45\sim1.64\mu$ mの波長の光に対し利得が得られる波長幅が80n m以上であり、また、前記熱的損傷が起りにくい光増幅ガラスの提供を目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、マトリクスガラスに0.01~10重量%のErを添加した光増幅ガ 20ラスであって、該マトリクスガラスが、実質的にモル%表示で、

B i 2O3	20~80,				
B_2O_3	$0 \sim 74.89$				
S i O ₂	0~79.99,				
CeO2	$0.01 \sim 10$				
L i 20	$0 \sim 50$				
T i O ₂	$0\sim50$				
ZrO2	0~50,				
SnO2	0~50,				
WОз	0~30,				
T e O ₂	0~30,				
G a 2O3	0~30.				
AlaOa	$0 \sim 1.0$				

からなり、かつ、B2O3およびSiO2の内の少なくともいずれか一方を含有することを特徴とする光増幅ガラスを提供する。

【0009】本発明の光増幅ガラスは、典型的には、 1.45~1.64 µ mの波長の光に対し利得が得られ る波長幅は80 n m以上である。また、そのガラス転移 40 点は、典型的には360℃以上である。

【0010】本発明の光増幅ガラスは、マトリクスガラスにErが添加されたものであり、Erの $^4I_{19/2}$ 準位から $^4I_{15/2}$ 準位への誘導放出遷移を利用する。図5は Er^{3+} イオンのエネルギー準位を示す図であり、上準位 $^4I_{13/2}$ 準位から下準位 $^4I_{15/2}$ 準位への遷移により発光することを示している。

【0011】なお、本発明の光増幅ガラスが、従来知られているEr添加石英系ガラスに比べより広い波長範囲で発光するのは、以下の理由によるものと推定される。

すなわち、本発明の光増幅ガラスには重元素イオンであるBiイオンが高濃度で含有されているため、ガラス中の光一電場相互作用が大きい。そのため、シュタルク効果により*I_{13/2}準位や*I_{15/2}準位等のErのエネルギー準位の幅が広くなっており、より広い波長範囲で発光する。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の光増幅ガラスは、1.45~ 1.64μ mの波長の光に対し利得が得られる波長幅が80nm以上であることが好ましい。より好ましくは90nm以上、さらに好ましくは100nm以上、特に好ましくは110nm以上である。

【0013】Erを含有する本発明の光増幅ガラスを光増幅器として使用する場合、通常は励起光および信号光としてレーザー光が使用され、前記信号光はErの*I13/2準位から*I15/2準位への誘導放出遷移を利用して増幅される。

【0014】本発明の光増幅ガラスのガラス転移点は3 60℃以上であることが好ましい。その理由は、光増幅 のための励起光として強度の大きいレーザー光を使用す るとガラスの温度が局所的に高くなり、ガラス転移点が 360℃未満では、ガラスが熱的に損傷し、その結果光 損失が増加して光増幅が不充分となるおそれがあるから である。より好ましくは380℃以上、さらに好ましく は400℃以上、特に好ましくは410℃以上である。 【0015】光増幅を目的としてマトリクスガラスに添 加されるErの量は、コアガラスとクラッドガラスとか らなる光増幅媒体 (光増幅ファイバ、光増幅媒体、等) が長い場合は少なく、光増幅媒体が短い場合は多くされ 30 る。本発明におけるErの添加量は0.01~10重量 %である。0.01重量%未満では、期待する光増幅特 性が得られない、特に光増幅率が低下する。好ましくは 0. 1 重量%以上、より好ましくは0. 2 重量%であ る。10重量%超では、ガラス化が困難になる、また は、濃度消光が起こり光増幅特性、特に光増幅率が不充 分となる。好ましくは8重量%以下、より好ましくは6 重量%以下である。なお、Erの添加量は外掛けで表示 する、すなわち、マトリクスガラスを100重量%とし

【0016】次に、マトリクスガラスの成分について、モル%を単に%と表示して以下に説明する。Bi₂O₃は必須成分である。その含有量が20%未満では光増幅特性、特に光増幅率が不充分になる。好ましくは25%以上、より好ましくは30%以上である。80%超では、ガラス化が困難になる、または、ファイバ加工時に失透する、または、ガラス転移点が低くなりすぎる。好ましくは70%以下、より好ましくは65%以下、特に好ましくは60%以下である。ここでいう失透とは結晶析出の顕著なものであり、ファイバ加工時にファイバ切れを

て表示する。また、ここでいう光増幅特性は、光増幅

率、利得が得られる波長幅、等を含む。

起したり、光増幅ガラスファイバとしての使用時にファ イバ破壊を起したりするものである。

【0017】B2O3およびSiO2はネットワークフォ ーマであり、ガラス作製時の結晶析出を抑制してガラス 形成を容易にするために、少なくともいずれか一方を含 有しなければならない。この場合、B2O3のみを含有し SiO₂を含有しなくてもよいし、SiO₂のみを含有し B₂O₃を含有しなくてもよいし、B₂O₃およびS i O₂ の両者を含有してもよい。B2O3およびSiO2のいず れをも含有しないと、ガラス化が困難になる。なお、S 10 i Ozはガラス作製時の結晶析出を抑制してBi2O3含 有量を高くする効果も有する。

【0018】B₂O₃およびSiO₂の含有量の合計は、 5~74.89%の範囲にあることが好ましい。5%未 満では、ガラス化が困難になるおそれがある、または、 光増幅率が不充分になるおそれがある、または、ファイ バ加工時に失透するおそれがある。より好ましくは10 %以上、特に好ましくは15%以上である。74.89 %超では、光増幅率が不充分となるおそれがある。より 好ましくは74. 79%以下、さらに好ましくは63% 20 以下、特に好ましくは60%以下、最も好ましくは55 %以下である。

【0019】B₂O₃を含有する場合、その含有量の上限 は74.89%である。74.89%超では光増幅特性 が不充分になる。好ましくは74.79%以下、より好 ましくは69%以下である。

【0020】また、B2O3を含有する場合、その含有量 は15%以上であることが好ましい。15%未満ではガ ラス化が困難になるおそれがある。より好ましくは20 %以上、特に好ましくは24%以上である。

【0021】また、SiO₂の含有量が15%以上の場 合、B₂O₃の含有量は14.99%以下であることが好 ましい。14.99%超では光増幅特性が不充分になる おそれがある。より好ましくは10%以下である。

【0022】SiO2を含有する場合、その含有量の上 限は79.99%である。79.99%超では光増幅特 性が不充分になる。好ましくは74.89%以下、より 好ましくは74.79%以下、さらに好ましくは70% 以下、特に好ましくは60%以下、最も好ましくは50 %以下である。

【0023】また、B₂O₃の含有量が14.99%以下 の場合、SiO₂の含有量は15%以上であることが好 ましい。15%未満ではガラス化が困難になるおそれが ある。より好ましくは20%以上、特に好ましくは30 %以上である。

【0024】CeO2は、ガラス組成中のBi2O3がガ ラス溶融中に還元して金属ビスマスとして析出しガラス の透明性を低下させることを抑制する効果を有し、必須 である。CeO₂の含有量が0.01%未満では、その 効果が不充分となる。好ましくは0. 1%以上、より好 50

ましくは0.15%以上である。10%超ではガラス化 が困難になる。好ましくは5%以下、より好ましくは1 %以下、特に好ましくは0.5%以下である。

[0025] Li2O、TiO2、ZrO2およびSnO2 はいずれも必須ではないが、ファイバ加工時の失透を抑 制してBi₂O₃の含有量を高くするために、それぞれ5 0%までの範囲で含有してもよい。

[0026] SiO2, Li2O, TiO2, ZrO2#1 びSnO₂はいずれも必須ではないが、これらからなる 群から選ばれる1種以上を合計で50%まで含有しても よい。50%超では光増幅特性が不充分になるおそれが ある。

【0027】WOaは必須ではないが、利得が得られる 波長幅を大きくするために30%まで含有してもよい。 その含有量が30%超では光増幅率が低下するおそれが ある。より好ましくは20%以下、特に好ましくは15 %以下である。

【0028】TeO2も必須ではないが、利得が得られ る波長幅を大きくするために30%まで含有してもよ い。その含有量が30%超では光増幅率が低下するおそ れがある。より好ましくは20%以下、特に好ましくは 17%以下である。

【0029】Ga₂O₃も必須ではないが、利得が得られ る波長幅を大きくするために、またはファイバ加工時の 失透を抑制するために、30%まで含有してもよい。そ の含有量が30%超では光増幅率が低下するおそれがあ る。より好ましくは20%以下、特に好ましくは17% 以下である。Ga2O3を含有する場合はその含有量は 0. 1%以上であることが好ましい。より好ましくは2 30 %以上である。

【0030】WO₃、TeO₂およびGa₂O₃の含有量の 合計は0.1~30%であることが好ましい。0.1% 未満では、利得が得られる波長幅が小さくなりすぎるお それがある。より好ましくは1%以上、特に好ましくは 2%以上、最も好ましくは4%以上である。30%超で は光増幅率が低下するおそれがある。より好ましくは2 7%以下、特に好ましくは25%以下である。

【0031】WO₃およびTeO₂の含有量の合計は27 %以下であることが好ましい。27%超では結晶が析出 しやすくなり、ガラス化やファイバ加工が困難になるお それがある。より好ましくは25%以下である。

【0032】TeO2およびGa2O3の含有量の合計は 20%以下であることが好ましい。20%超ではガラス 転移点が低くなりすぎるおそれがある。より好ましくは 18%以下である。

【0033】A12〇3は必須ではないが、ガラス作製時 の結晶折出を抑制してガラス形成を容易にするために、 または、ファイバ加工時の失透を抑制するために10% まで含有してもよい。その含有量が10%超では光増幅 特性が光増幅率が低下するおそれがある。より好ましく

は9%以下、特に好ましくは8%以下である。 $A1_2O_3$ を含有する場合はその含有量は0.1%以上であることがより好ましい。さらに好ましくは1%以上、特に好ましくは5.1%以上、最も好ましくは6%以上である。【0034】 Ga_2O_3 および $A1_2O_3$ の少なくとも一方を含有し、それらの含有量の合計が $2\sim30$ %であることが好ましい。2%未満ではファイバ加工時にガラスが失透するおそれがある。より好ましくは4%以上、特に好ましくは7%以上である。30%超では光増幅率が低下するおそれがある。より好ましくは25%以下、特に10好ましくは20%以下である。

【0035】本発明の光増幅ガラスは実質的に上記成分からなるが、上記成分以外の成分を合計で10%まで含有してもよい。たとえば、ファイバ加工時の失透を抑制したり、ガラス化を容易にしたりするために、BeO、MgO、CaO、SrO、BaO、Na₂O、K₂O、Cs₂O、La₂O₃、ZnO、CdO、In₂O₃、GeO₂、PbO、などを含有してもよい。

【0036】本発明の光増幅ガラスの第1の好ましい態 様においては、マトリクスガラスが実質的にモル%表示 20 で、

 Bi_2O_3 20~70,

 B_2O_3 0~14.99、

 SiO_2 15~79.99,

 CeO_2 0.01~10,

からなる。前記マトリクスガラスは、上記4成分以外の 成分を合計で10モル%まで含有してもよい。

【0037】本発明の光増幅ガラスの第2の好ましい態 様においては、マトリクスガラスが、実質的にモル%表 示で、

 Bi_2O_3 30~80,

 B_2O_3 15~69,

 SiO_2 $0\sim 50$

 $C e O_2 = 0.01 \sim 10$

 Li_2O $0\sim50$

 $T i O_2 \qquad 0 \sim 50$

 ZrO_2 $0\sim50$

 SnO_2 $0\sim 50$

からなり、前記マトリクスガラスにおけるSiO2、L i2O、TiO2、ZrO2およびSnO2の含有量の合計 40 が0~50モル%である。

【0038】第2の好ましい態様における、より好ましい態様2Aにおいては、マトリクスガラスは、実質的にモル%表示で、

 Bi_2O_3 30~80,

 B_2O_3 15~40.

 SiO_2 · $0\sim50$,

 CeO_2 0.01~10,

 Li_2O 0~50,

 $T i O_2 \qquad 0 \sim 50$

 $Z r O_2$ $0 \sim 5 0$, $S n O_2$ $0 \sim 5 0$,

からなり、前記マトリクスガラスにおける SiO_2 、 Li_2O 、 TiO_2 、 ZrO_2 および SnO_2 の含有量の合計が 2 モル%以上 5 0 モル%以下である。

【0039】より好ましい態様2Aにおいては、利得が得られる波長幅は80nm以上であり、利得に対応する後述の発光強度ピーク値は6以上であり、利得が大きい光増幅ガラスを提供できることに特徴がある。

【0040】第2の好ましい態様における、より好ましい他の態様2Bにおいては、マトリクスガラスは、実質的にモル%表示で、

Bi₂O₃ 30~59,

B₂O₃ 40超69以下、

SiO2 0以上29.9未满、

 $C e O_2$ 0. 01~10,

Li₂O 0以上29.9未満、

TiO₂ 0以上29.9未满、

ZrO₂ 0以上29.9未満、

SnO₂ 0以上29.9未満、

からなり、前記マトリクスガラスにおけるSiO₂、Li₂O、TiO₂、ZrO₂およびSnO₂の含有量の合計が0モル%以上29.9モル%未満である。

【0041】より好ましい態様2Bにおいては、利得が得られる波長幅は90nm以上であり、発光強度ピーク値は5以上であり、利得が得られる波長幅が大きい光増幅ガラスを提供できることに特徴がある。

【0042】第2の好ましい態様におけるマトリクスガラスは実質的に上記8成分からなり、これ以外の成分は30 合計で10モル%まで含有してもよい。この制限内であれば、たとえば、MgO、ZnO、BaO、Al₂O₃を合計で10重量%まで添加してもよい。ここでは、上記8成分の含有量の合計を100重量%とする。

【0043】本発明の光増幅ガラスの第3の好ましい態様においては、マトリクスガラスが、実質的にモル%表示で、

B i $_{2}O_{3}$ 25~70,

 B_2O_3 0~74.89,

 SiO_2 0~74.89,

 $C e O_2 = 0.01 \sim 10$

 $WO_3 0 \sim 30$

 $T e O_2$ $0 \sim 30$

 Ga_2O_3 $0\sim30$

からなり、前記マトリクスガラスにおいて、B₂O₃およびS_iO₂の含有量の合計が5~74.89モル%、かつ、WO₃、TeO₂およびGa₂O₃の含有量の合計が0.1~30モル%である。前記マトリクスガラスは上記7成分以外の成分を合計で5モル%まで含有してもよく、MgO、BaO、ZnO、Al₂O₃、がそのような

50 成分として例示される。

【0044】本発明の光増幅ガラスの第4の好ましい態 様においては、マトリクスガラスが、実質的にモル%表 示で、

 Bi_2O_3 25~70.

 B_2O_3 0~74.79,

 SiO_2 0~74.79.

 CeO_2 0.01~10,

 WO_3 ' 0~30,

 TeO_2 0~30,

 Ga_2O_3 $0\sim30$,

 Al_2O_3 0. 1~10,

からなり、前記マトリクスガラスにおいて、 B_2O_3 およびS iO_2 の含有量の合計が $5\sim74$. 79 モル%、かつ、 WO_3 、 TeO_2 および Ga_2O_3 の含有量の合計が0. $1\sim30$ モル%である。前記マトリクスガラスは上記8成分以外の成分を合計で5 モル%まで含有してもよい。たとえば、ガラス作製時の結晶化を抑制しガラス形成をより容易にするために、MgO、BaO、ZnOなどを含有してもよい。

【0045】本発明の光増幅ガラスの第3または第4の 20 好ましい態様においてはBiイオンの他に、やはり重元素イオンであるWイオン、Teイオン、Gaイオンの内の少なくとも1種が含まれている。そのためにガラス中の光一電場相互作用がより大きくなり、その結果本質的にブロードな遷移である電気双極子遷移の寄与がより大きくなり、より広い波長範囲で発光する可能性が高い。

【0046】本発明の光増幅ガラスの作製法については特に制限はない。たとえば、原料を混合し、白金ルツボ、アルミナルツボ、石英ルツボやイリジウムルツボ中に入れて800~1300℃で空気中で溶融し、得られ30た融液(溶融ガラス)を所定のモールドにキャストする溶融法によって本発明の光増幅ガラスを作製できる。また、溶融法以外の方法、たとえばゾルゲル法や気相蒸着法などにより本発明の光増幅ガラスを作製してもよい。なお、このようにして作製した本発明の光増幅ガラスをもとに、プリフォームを作成してファイバ化したり、または二重るつぼ法によってファイバ化したりすることによって光増幅ガラスファイバを作成できる。

[0047]

評価した。

【実施例】表 $1 \sim 6$ に本発明の光増幅ガラスの組成と特 40性を示す。組成は、表のB i $_2$ O $_3$ からE r までの欄に示されている。E r については重量%で表示した添加量であり、他の成分についてはモル%で表示されている。特性については、示差熱分析(DTA)により測定したガラス転移点(T_s 、単位: $^{\circ}$ C)、発光強度ピーク値(I_s 、任意単位)、利得が得られる波長幅(Δ λ 、単位: n_m)、ファイバ加工時の失透性(D)、を表示する。Dについては以下に説明する。なお、 T_s 、 I_s 、Dについては一部の光増幅ガラスについてのみ測定または

【0048】ファイバ加工時の失透性(D)・・・光増幅ガラスをプリフォームに成形し、550℃でファイバ化する。得られたガラスファイバの表面を光学顕微鏡で観察し、結晶析出が認められない場合を○、問題はないが結晶析出が若干認められる場合を△、によりそれぞれ表わす。

【0049】表1の例1~例5は本発明の光増幅ガラスの第1の好ましい態様の例である。図1は、例1の光増幅ガラス中のEr³・イオンの上準位⁴I13/2準位から下10 準位⁴I15/2準位への発光における発光強度、および従来から知られている石英系ガラス(Er添加石英系ガラス)中のEr³・イオンの同様の発光における発光強度の波長依存性を比較したものである。発光強度の単位は任意単位である。

【0050】図1において、発光強度が2.5以上の場合に利得が得られることがわかっている。利得が得られる波長範囲は、石英系ガラスの場合1520~1560 nmであり、その Δ 1は40nmである。これに対し、例1の光増幅ガラスの場合1480~1620nmで利得が得られ、その Δ 1は140nmである。すなわち、例1の光増幅ガラスの Δ 1は石英系ガラスの Δ 1の3.5倍に達する。例2~例5の光増幅ガラスの Δ 1の約3.5倍であった。

[0051]

【表1】

	99 1	9 12	例 3	例 4	例 5
81,0,	65	60	41.85	40	30
8,0,	14. 5	9.8	10		0.2
SiO,	20.4	30	48	59.8	69. 4
CeO ₂	0. 1	0.2	0. 15	0.2	0.4
Er	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Ť,	_	-	418	420	450
Δλ.	140	138	135	138	135

【0052】表2および表3に示される例6~例15は、本発明の光増幅ガラスの第2の好ましい態様の例である。例6~例10は、より好ましい態様2Aの例である。例11~例15は、より好ましい態様2Bの例である。図2は、例6および例11の光増幅ガラス中のEr³+イオンの上準位*I13/2準位から下準位*I15/2準位への発光における発光強度、および従来から知られている石英系ガラス(Er添加石英系ガラス)中のEr³+イオンの同様の発光における発光強度の液長依存性を比較したものである。発光強度の単位は任意単位である。

【0053】図2において、発光強度が2.5以上の場合に光増幅利得が得られることがわかっている。例6の光増幅ガラスの発光強度ピーク値I。は6.2、例11の光増幅ガラスのI。は5.7であり、いずれも利得が50得られる。一方、石英系ガラスのI。は5.4である。

【0054】利得が得られる波長範囲は、例6の光増幅 ガラスの場合、1480~1580nmであり、その Δ んは100nmである。例11の光増幅ガラスの場合1 480~1600nmで利得が得られ、その Δ んは12 0nmである。例6、例11の光増幅ガラスの Δ んは、 石英系ガラスの Δ んのそれぞれ2.5倍、3倍に達する。

【0055】例 $7\sim$ 例10および例 $12\sim$ 例15の光増幅ガラスについても I_p および Δ λ を測定した。測定結果を、例6および例11に対する結果とともに表に示す。例 $7\sim$ 例10の光増幅ガラスの Δ λ は、石英系ガラスの約2.5倍、例 $12\sim$ 例15の光増幅ガラスの Δ λ は、石英系ガラスの約3倍であった。また、例 $6\sim$ 例100の光増幅ガラスの 1_p は6.1以上であり、石英系ガラスに比べより大きな利得が得られる。

[0056]

【表2】

nkr

Ŕ,jr

	Ø4 6	947	64 8	例 9	例 10
Bi,0,	42. 6	49. 5	65	67	74
B ₂ O ₂	28. 5	25	29. 5	25	15.8
SiO _z	28. 5	5		-	
CeO,	0.4	0.5	0.5	0. 2	0. 2
Li ₂ 0	-	-	-	-	З
TiO _z	-	-	-	7.8	7
Zr0,]-	5	_	<u> </u>
SnO _z	_	20		-	
Er	0. 4	0.4	0. 4	0.4	0.4
T.	420	410	380	365	360
I,	6. 2	6. 4	6. 1	6. 2	6. 9
Δλ	100	102	103	102	100

【0057】 【表3】

例11 例 12 例 13 例 14 例 15 43 50 31 41 34. 6 Bi,0, 56. 9 55 B₂O₂ Sio 7.8 8.85 3.8 25 0. <u>4</u> 0. 1 0.2 0.15 0.2 Li,0 TiO ZrO, SnO₂ 0.4 Er 0.4 430 420 405 435 425 Т, 5. 1 5. 2 5.7 5. 7 5. 3 120 121 125 120 Δλ

12

【0058】表4および表5に示される例16~例27は、本発明の光増幅ガラスの第3の好ましい態様の例である。図3は、例16の光増幅ガラス中のEr³・イオンの上準位⁴I_{13/2}準位から下準位⁴I_{15/2}準位への発光に20 おける発光強度、および従来から知られている石英系ガラス(Er添加石英系ガラス)中のEr³・イオンの同様の発光における発光強度の波長依存性を比較したものである。発光強度の単位は任意単位である。

【0059】図3において、発光強度が2.7以上の場合に利得が得られることがわかっている。利得が得られる波長範囲は、例16の光増幅ガラスの場合、1486~1604nmであり、そのΔλは118nmである。このΔλは石英系ガラスのΔλの約3倍に達する。例17~例27の光増幅ガラスについてもΔλを測定した。30 測定結果を表に示す。いずれのΔλも石英系ガラスの約3倍である。

[0060] -

【表4】

	例 16	例 17	何 18	例 19	何 20	例 21
Bi ₂ 0,	42.8	44.8	54. 8	34.8	44.8	62. 8
В ₂ О ₃	27	50	27	27		16
S10,	13			15	50	4
CeO _z	0. 2	0. 2	0. 2	0.2	0.2	0. 2
WO,	-		4	10	5	-
TeO ₂	17	5	14	13	<u> -</u>	17
Ga ₂ O ₃			_	<u> </u>	<u> </u>	
Er	0.4	0. 4	0.4	0.4	0.4	0.4
т,	420	415	390	450	435	360
Δλ	118	121	120	119	115	116

•	•

	例 22	例 23	例 24	例 25	妈 26	例 27
Bi _z o,	42.8	44. 8	54. 8	34. 8	44.8	62. 8
B ₂ O ₃	27_	50	27	27		16
SiO,	13		_	15	35	4
CeO ₂	0.2	0. 2	0. 2	0. 2	0.2	0. 2
WO ₃	-	-	4	10	5	
TeO ₂	-	-	10	-	_	7
Ga ₂ O ₃	17	5	4	13	15	10
Er	2.0	0.4	Q. 4	0.4	3.0	0. 4
Т.	413	420	395	450	430	362
Δλ	125	120	119	119	128	115
D	Δ	-	-	-	-	

【0062】表6に示される例28~例31は、本発明の光増幅ガラスの第4の好ましい態様の例である。図4は、例30の光増幅ガラス中のEr³⁺イオンの上準位⁴ I_{13/2}準位から下準位⁴ I_{15/2}準位への発光における発光強度、および従来から知られている石英系ガラス(Er添加石英系ガラス)中のEr³⁺イオンの同様の発光における発光強度の波長依存性を比較したものである。発 20光強度の単位は任意単位である。

【0063】図4において、発光強度が2.7以上の場合に利得が得られることがわかっている。利得が得られる波長範囲は、例30の光増幅ガラスの場合1487~1610nmであり、そのΔλは123nmである。これは石英系ガラスのΔλの約3倍である。例28、例29、例31のΔλも表6に示すが、いずれも石英系ガラスのΔλの約3倍である。

【0064】また、例28~例31の光増幅ガラスは、ファイバ加工時における結晶の析出が認められずファイ 30 バ成形性に優れている。第4の好ましい態様には属さない前掲の例22の光増幅ガラスは、ファイバ加工時に結晶の析出が若干認められた。

[0065]

【表 6】

-				
	6 4 28	贸 29	例 30	例 31
Bi ₂ 0,	42.8	44.7	42.8	54.8
B ₂ O ₃	27	<u> </u>	27	24
SiO ₂	13	30	6	<u> </u>
CeO _z	0. 2	0.2	0. 2	0.2
170 ₃		5		4
TeO _z			17	14
$Ga_{\mu}O_{\mu}$	10	15	·	<u> </u>
A1,0,	7	5.1	7	3
Er	2. 0	3.0	0.4	0.4
T,	414	428	422	391
Δλ	123	125	116	118
D	0	0	0	0

[0066]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の光増幅ガラスにより、より広帯域の光増幅が可能になり、波長多重伝送方式による大容量の情報伝送が可能になる。また、励起光として強度の大きいレーザー光を使用しても熱的な損傷が起りにくい。 さらにファイバ加工時における結晶析出が起りにくくファイバ加工が容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光増幅ガラスと従来から知られている 石英系ガラスの発光スペクトルを示す図。

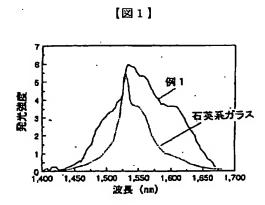
【図2】本発明の光増幅ガラスと従来から知られている 石英系ガラスの発光スペクトルを示す図。

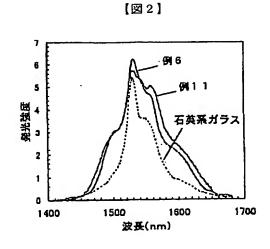
【図3】本発明の光増幅ガラスと従来から知られている 石英系ガラスの発光スペクトルを示す図。

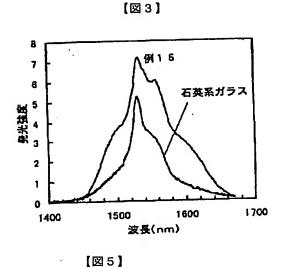
【図4】本発明の光増幅ガラスと従来から知られている 石英系ガラスの発光スペクトルを示す図。

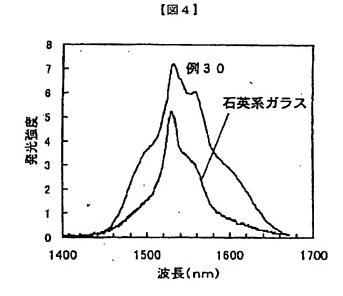
【図5】Er³+イオンのエネルギー準位を示す図。

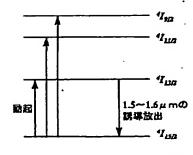
40











フロントページの続き

£ ;-

(51) Int. C1. 7 C O 3 C 3/15 4/12 . 識別記号

F I C 0 3 C 3/15 4/12 テーマコード(参考)

```
Fターム(参考) 4G062 AA07 BB01 BB05 BB07 CC10
         DA01 DA02 DA03 DA04 DA05
         DA06 DA07 DB01 DB02 DB03
         DC01 DC02 DC03 DC04 DC05
         DC06 DC07 DD01 DE01 DF01
         EA01 EA02 EA03 EA04 EA05
         EB01 EC01 ED01 EE01 EF01
         EG01 FA01 FB01 FB02 FB03
         FB04 FB05 FC01 FC02 FC03
         FC04 FC05 FD01 FE01 FE02
         FE03 FE04 FE05 FF01 FG01
         FH01 FJ01 FK01 FL02 FL03
         GA04 GA05 GA06 GA07 GB01
         GC01 GD01 GD02 GD03 GD04
         GE01 HH01 HH03 HH05 HH06
         НН07 НН08 НН11 НН13 НН15
         HH17 HH20 JJ01 JJ03 JJ05
         JJ07 JJ10 KK01 KK03 KK05
         KK06 KK07 NN01
```

5F072 AB07 AB08 AK06 YY17